

中国における特許ライセンス情報の収集

Patent license information in China



アジア特許情報研究会 **伊藤 徹男**

2004～現在：日本知的財産協会セミナー講師、2007～2009：検索競技大会委員、2009～2011：発明推進協会セミナー講師、2008年：アジア特許情報研究会設立

✉ patentsearch2006@yahoo.co.jp

1 はじめに

中国における特許出願は急激な伸びを示し、2015年には特許110万件、実用新案112万件に達したことが中国特許庁から発表されている¹⁾。2016年4月時点の中国国内出願人の出願でも、特許は前年比+33%強、実用新案は前年比+11%となっており、2015年度の出願数を上回る勢いである。外国からの出願では、米国やドイツが前年比5～7%の伸びを示しているのに対し、日本は-2.2%と漸減傾向がみられる。

このような状況の元、特許やノウハウの技術移転管理などが法制度やその運用の観点から論じられ、中国に関する最近の主な論考、報告書だけでも数多くのもが存在する^{2)～10)}。

中国で事業を展開するには、自ら中国に出願して権利確保することは当然のこととしても、他社から権利を取得したり、譲渡したりして権利を活用することも重要であり、したがって、そのような情報の把握も必要となる。

中国特許庁の各種統計情報の1つとして2002年以降公告されることとなったライセンス情報が「專利実施許可合同备案登記相关信息」として中国特許庁ホームページに公開されるようになった。但し、ここには2013年の途中(2013年第二季)までの情報であり、その後の最新情報の収録は現時点ではない。また、この情報はHTMLあるいはエクセル形式で各年毎に公開されているが、通年をデータベース的に検索することができない¹¹⁾。

他方、中国で専利と呼ばれる特許、実用新案、意匠のライセンス、権利移転情報がいくつかの法律状態データベースで検索できるようになっている。そこで本稿では、これらデータベースを活用したライセンスや権利移転情報の収集法と検索上のノウハウを調査の観点から紹介したい。ここではライセンス情報のみに着目するのではなく、ライセンスに当たっては当初の出願人から権利が移転し、権利譲受人がライセンサーとなってライセンスされるケースもあることに鑑み、権利移転情報についても同時に扱うこととした。

2 中国における専利ライセンス契約と法規制

中国におけるライセンスに関する法規制の詳細については、前項に示した多くの論考を参照いただきたいが、ここではライセンス調査をするに当たって必要となる最小限の知識について整理し、次項以降の調査ノウハウの参考としたい。

中国へのライセンスなどを含む技術輸出に当たっては、2001年12月のWTO加盟に伴って旧「技術導入契約管理条例」が廃止されて「技術輸出入管理条例」が2002年から施行され、技術輸出入契約の登記が義務付けられることとなった(技術輸出入契約登記管理規則：2009年改正)。特許ライセンスに関する登記、管理制度としては「特許実施許諾契約届出管理規則」が設けられており、専利法においても、特許などの専利をラ

イセンスする場合には、「実施許諾契約」を締結し（専利法第12条）、契約発効日から3か月以内に中国知識産権局に、ライセンス契約を届け出ることが義務付けられ（専利法実施細則第14条）、諸規則が制定されている。

当然のことながら、ライセンス契約は専利の有効期間内のみ有効であるが、専利の有効期間満了後（あるいは専利権失効後）はライセンス契約が無効であることやライセンシーに対する不利益条項の禁止なども詳細に、これらの法律に定められている。

ライセンス登記情報は、法律状態データベースとして中国特許庁および傘下の組織である中国知識産権出版社IPPHが運営するデータベースCNIPRに収録され、調べることが可能となっている。法律状態データベースには、ライセンスや権利移転情報だけでなく、専利の出願から登録、年金納付・年金未払いによる失効状況なども収録されている。

中国におけるライセンス種別には以下のものがあり（表1）、ライセンス種別の状況と共に（表2）2002年以降に公告されることとなったライセンス特許の推移（表3）を示した。

表1 ライセンス種別

独占許可（専用実施）
ライセンス地域でライセンシー以外（ライセンサーを含む）に実施権を許諾しない。
排他許可（非独占実施）
ライセンシーと共にライセンサーにも実施権がある。
普通許可（通常実施）
複数のライセンスと共にライセンサーにも実施権がある。
分許可（二次ライセンス）
ライセンシーがさらに第三者にライセンスすることを許諾したもの。
交叉許可（クロスライセンス）
相互にライセンスし合うもの。

表2 ライセンス種別の登録状況

許可類型	特許	実案	意匠
排他許可	1191	995	465
独占許可	31174	66625	21180
普通許可	18744	4640	2159
分許可	156	78	41
交叉許可	121	35	0
表記なし	47	17	16

表3：ライセンス登録件数

公告日	特許		実案		意匠
	内国出願	PCT出願	内国出願	PCT出願	
2002	428	10	0	0	43
2003	142	0	291	0	76
2004	245	18	105	0	128
2005	131	17	18	0	134
2006	325	149	50	0	36
2007	96	189	29	0	117
2008	1445	76	1745	0	744
2009	7074	174	9682	1	3409
2010	4848	215	13242	0	2987
2011	6553	271	12376	1	4426
2012	5123	522	10018	0	2446
2013	7333	505	9589	0	3450
2014	8710	1939	9815	1	5211
2015	7441	598	8741	0	1292

表2および表3の件数は、2016年7月現在、成立しているものである（変更や抹消・失効分を除去）。

特許については、2014年に10000件に達しているのを除けば、2009年以降、5000～8000件で推移している。実用新案や意匠も2009年以降は2007年以前と比べて大幅な増加となっている。

このような専利ライセンス情報が登記され公告される制度は、中国のみにおける特異なものではなく、タイやベトナムの法制度においても同様に施行されている¹²⁾。

3 ライセンス、権利移転情報の抽出

中国における専利（特許、実用新案、意匠）ライセンス、権利移転情報の調査は、以下の4つの手段から可能である。

- ①中国特許庁事務データベース
- ②専利検索データベース
- ③法律状態データベース
- ④運営情報データベース

②～④は、中国知識産権出版社（IPPH）が運営するデータベース「CNIPR」を用いて、あるいは②、③は、中国語検索も可能な商用の中国特許データベースでも検索できる。

以下、①～④のそれぞれのデータベースの検索方法、抽出結果の出力について紹介する。①～③では、ライセンスや権利移転検索以外に出願から登録、年金納付などの審査経過情報も検索できるが、ここでは主として専利



権のライセンスおよび権利移転情報の検索法に限定する。

3.1 中国特許庁事務データベース

中国特許庁のホームページから、[專利公布公告查詢—事務数据查詢](http://epub.sipo.gov.cn/flzt.jsp)と辿っていくと検索画面が開く (http://epub.sipo.gov.cn/flzt.jsp)。

検索できるフィールドは、專利類型 (特許、実用新案、意匠の別)、事務類型 (審査請求、登録、放棄、ライセンスなどの法律状態項目)、出願番号、法律状態公告日、事務データベース情報 (法律状態項目だけでなく、ライセンサーなどの法律状態情報も) と少なく、フィールド内での演算 (and, or, not) ができない (ライセンサー (譲与人: 譲与人) やライセンシー (受让人: 譲受人) は単独では検索できるが、「譲与人: 华为技术 and 受让人: 苹果」などの演算はできない)。

複数の出願番号を検索できず、公告日の範囲検索 (例えば、2000年~2015年を「2000 to 2015」と指定) もできない。

3.2 專利検索データベース

IPPHが運営する專利検索データベース CNIPRには、本来の中国版の他に2013年に登場した日本版がある。日本版 CNIPRは、日本のユーザー向けにインターフェイスなどを日本語化しただけでなく、検索も中国語と英語のハイブリッド検索が可能であるなど中国版 CNIPRと異なる機能があるが、2014年に「法律状態」フィールドが追加され、各種の法律状態項目からも絞り込めるようになった。

2015年には中国版 CNIPRにも「法律状態」フィールドが追加されたが、日本版 CNIPRにはない簡易解析機能 (出願人やIPC分類などのランキング) と共に「法律状態」検索は有料となった。

複雑な検索式を入力するためのコマンド検索領域なども設けられ、最近では多くの日本企業でも中国特許検索用ツールとして活用されているが、ここでは説明を割愛させていただきたい。

CNIPR 專利検索画面は、図1に示すように各種の検索フィールドが準備されており、ライセンスの場合には「法律状態」フィールドに「專利实施许可合同备案的生效」

(簡易的には「实施许可」で可能)、権利移転の場合には「專利权的转移」と入力することでライセンスや権利移転に絡む特許や実用新案を抽出することができる。

入力可能な法律状態項目はフィールド横のアイコンでサポートされているが、ここで入力する法律状態用語は年代 (法改正などの都度) によって表記が若干変化しているので注意が必要である。

しかし、この法律状態フィールドに「譲与人 (譲与人): 华为技术」「受让人 (譲受人): 苹果」と入力してもライセンサーやライセンシーを検索できない。出願人フィールドに「出願人名」、法律状態フィールドに「实施许可」と入力してもライセンスに絡んだ特定出願人の特許などが検索されるだけである。出願特許などが権利移転を経て、ライセンスされる場合などもあり、必ずしも、出願人=ライセンサーではないことに注意すべきである。

出願人が権利を移転した後、譲受人がライセンスをした情報も法律状態フィールドに「实施许可 (ライセンス)」として収録されるために当該出願人のライセンス案件と勘違いすることになるのである (後述)。

The image shows a search interface for the CNIPR database. It contains several input fields and checkboxes arranged in two columns. The fields include:

- 申請 (專利) 号: [input field]
- 公开 (公告) 号: [input field]
- 名称: [input field]
- 权利要求书: [input field]
- 申請 (專利) 人: [input field with '华为技术' selected]
- 国际專利主分类号: [input field]
- 地址: [input field]
- 民族專利: [input field]
- 代理机构: [input field]
- 名称, 摘要: [input field]
- 申請日: [input field]
- 公开日: [input field]
- 摘要: [input field]
- 说明书: [input field]
- 发明 (设计) 人: [input field]
- 国际專利分类号: [input field]
- 國省代碼: [input field]
- 優先權: [input field]
- 代理人: [input field]
- 法律状态: [dropdown menu with '实施许可' selected]
- 最新法律状态: [input field]

図1 專利検索データベース (中国版 CNIPR)

3.3 法律状態データベース

CNIPRの法律状態データベースにおいて検索できるフィールドは、出願番号、法律状態公告日、法律状態、法律状態情報の4つのみである (図2)。しかし、中国特許庁事務データベースとは異なり、フィールド内で and, or, not などの演算が可能である。出願番号フィールドには、140件までの番号を or 演算できる。

專利種別のチェックボックスはないが、出願番号フィールドに特許の場合には「CNO?1% or CN20??1% or CNO?8% or CN20??8%」と、実用新案の場合には「CNO?2% or CN20??2% or CNO?9% or CN20??9%」と入力すれば種別別の検

索が可能である(いずれも2000年以降出願の検索例)。また、出願番号の表記から特許や実用新案の内国出願かPCT出願かの区別も指定できる。

CNIPRの法律状態データベースは、中国版も日本版も同じ検索結果を示してくれるが、中国版は無料で利用でき、また、日本版CNIPRでは法律状態情報の検索結果をダウンロード(一括して50000件まで)できるなどの利点がある。

專利申請号:
 法律状态公告日:
 法律状态:
 法律状态信息: X

図2 法律状態データベース

「法律状態」フィールドでは、審査請求や登録の有無、見做放棄や拒絶、年金未納などの法律状態項目を検索できるが(このフィールドでは、前項「專利検索データベース」の法律状態フィールドと同様の情報が収録されており、ライセンスやライセンシーは検索できない)、中国版CNIPRも日本版CNIPRも2015年に法律状態フィールドとは別に「法律状態情報」フィールドが追加され、ライセンスやライセンシーのみならず、ライセンスの許可類型なども検索できるようになった。

法律状態情報には、表4、表5に示すような情報が収録されており、これらが検索可能となっている。

表4 專利權ライセンス情報例

申請号: CN200810065291.7	
法律状态: 专利实施许可合同备案的生效、变更及注销	
法律状态信息:	
专利实施许可合同备案的生效	(ライセンス登録)
IPC (主分類): H04W 52/24	(IPC筆頭分類)
合同备案号: 2015990000755	(ライセンス契約番号)
让与人: 华为技术有限公司	(ライセンサー)
受让人: 苹果公司	(ライセンシー)
发明名称: 资源映射...装置	(発明の名称)
申请日: 20100108	(特許出願日)
申请公布日: 20110413	(特許公開日)
授权公告日: 20120104	(特許登録日)
许可种类: 普通许可	(ライセンス許可類型)
备案日期: 20150827	(ライセンス契約登録日)

表5 專利權移轉情報例

申請号: CN00106539.4
法律状态公告日: 2012.01.04
法律状态: 专利申请权、专利权的转移
法律状态信息: 专利权的转移
IPC (主分類): G02F 1/1335
变更前权利人: 株式会社日立显示器
变更后权利人: 株式会社日本显示器东
共同专利权人变更前: 株式会社 IPS 先驱支援会社
变更后: 松下液晶显示器株式会社
登记生效日: 20111125

【法律状態データベースにおけるライセンサー(ライセンシー)検索時の留意点】

i) ライセンサー(ライセンシー)の入力

法律状態情報フィールドにライセンサー検索のつもりで「华为技术」(ファーウェイ)とだけ入力して検索すると、华为技术がライセンシーとなっているものも抽出される。ライセンサーに特定するには「让与人: 华为技术」と入力する必要がある。

ライセンサーが华为技术でライセンシーが苹果(アップル)の場合には、「(让与人: 华为技术 or 让与人 华为技术) and (受让人: 苹果公司 or 受让人 苹果公司)」とする。

ii) 異表記の網羅

ライセンサー(ライセンシー)の異表記も考慮して検索する点は、專利検索データベースにおける出願人検索と同様である。例えば、Philipsは、「皇家飞利浦电子、皇家飞利浦电子、皇家飞利浦电子、荷兰皇家飞利浦电子、飞利浦电子、飞利浦电子、飞利浦电子」のような異表記があるため、これらをor演算して「让与人: 皇家 or 让与人: 菲利 or 让与人: 荷兰皇家 or 让与人 皇家 or 让与人 菲利 or 让与人 荷兰皇家」とする(前方一致で可能)。

iii) 共ライセンサーの検索

複数のライセンサー(ライセンシー)は「让与人: 株式会社日本显示器、松下液晶显示器」のように併記されている。筆頭の日本显示器を検索する場合には、「让与人: 株式会社日本显示器」でよいが(この場合も、株式会社を省略して部分一致で「让与人: 日本显示器」では検索できない)、共ライセンサーを「让与人: 松下液晶显示器」

では検索できない。また、「譲与人 and 松下液晶显示器」と検索すると松下液晶显示器がライセンシーとなっているものも抽出される。したがって、共ライセンシーの検索は、「譲与人：株式会社日本显示器、松下液晶显示器」と検索せざるを得ない。

iv) その他

「譲与人：〇〇」などと検索するとライセンス契約の登録情報（専利実施許可合同备案的生效）の他、変更や抹消の情報も抽出される。登録情報のみ抽出するには、法律状態情報フィールドで「譲与人：〇〇」and「専利実施許可合同备案的生效」（「生效」が登録情報であることを示す）のようにand演算が必要である。

また、他のデータベースと同様にライセンス情報は時間と共に変化するので（経時的に登録情報が増え、登録されているものも失効して抹消される）、いつの時点の情報であるか、の把握も重要である。

3.4 運営情報データベース

CNIPR 中国版、CNIPR 日本版共に、ライセンス、専利権移転、質権設定情報が各別に検索できるデータベースであるが、いずれも有料である。CNIPR 日本版の運営情報データベース検索画面を図3に示した。

出願番号: CN0?1% or CN20??1% or CN0?8% or CN20??8%

発明の名称: _____

国際特許分類(IPC): _____

要約: _____

第一請求項: _____

許可方式: 選んでください ▼

契約登録: 発効 変更 取消

登録日: _____

変更日: _____

取消日: _____

契約登録番号: _____

特許権者: 松下液晶显示器

実施権者: _____

図3 運営情報データベース（日本版 CNIPR）

法律状態データベースとは異なり、要約、第1請求項からの用語検索が可能な他、ライセンス登録情報のみ抽出したい場合にはチェックボックスで変更や取消の情報を外すことができたり、契約の許可形式（専用実施か通常実施かなど）の選択も可能である。

当然ながら法律状態データベースではないので、審査経過情報や年金未納失効などの情報は収録されていない。

検索結果一覧は CNIPR 中国版、CNIPR 日本版共にダウンロードできず、現状では、結果を保存するには1ページ10件ごとをコピー&ペーストするしかないが、数百件以上の情報を取得するにはかなり手間である。大量のダウンロードの場合は CNIPR 日本版の法律状態データベースが適している。

共ライセンサーの検索も「譲与人（特許権者）」フィールドに「松下液晶显示器」などを入力すれば、ライセンシー分が検索されることはない（部分一致検索が可能）。

4 ライセンス情報の解析

4.1 解析データの抽出

前項、専利検索データベースで「ライセンスに関わる特許」の出願人を抽出し、そのランキングを内国出願人と外国出願人別に表6に示し、前項、法律状態データベースで抽出した「特許ライセンサー」ランキングを同様に内国人と外国人別に表7に示した。

表6は専利種別を特許に限定し、1990年～2015年の公開特許について法律状態フィールドに「実施許可」（ライセンス）を入力して得られた40010件の「ライセンスに関わる特許」の出願人ランキングである。

表7は、2002年～2015年に登記（公告）となった51250件のライセンス契約された特許について、法律状態データベースを検索して求めたライセンサーランキングである。表7のライセンス数値は、2016年7月現在、失効しているものを除いた有効なもののみである。

表6 ライセンスに関わる特許出願人ランキング

	中国国内出願人		外国出願人	
1	中兴通讯	841	日立ディスプレイ	491
2	华为技术	813	松下電器産業	322
3	浙江大学	532	日立製作所	242
4	华南理工大学	340	Samsung Electronics	223
5	比亚迪	296	Lubrizol	185
6	江南大学	256	Michelin	160
7	东华大学	237	Hon Hai Prec.	151
8	江苏大学	228	Bayer	150
9	天津大学	204	PPG Industries	141
10	西安交通大学	200	Delta Electronics	130
11	上海交通大学	178	ソニー	126
12	东南大学	175	LG Electronics	112
13	中国科学院计算技术研究所	170	Phillips	98
14	清华大学	164	マブチモーター	94
15	浙江工业大学	161	太陽インキ	94
16	鸿富锦精密工业	149	三洋電機	81
17	南京工业大学	145	パイオニア	81
18	华东理工大学	145	住友特殊金属	80
19	山东大学	124	Gyong Tong Bang Display	76
20	北京科技大学	118	シャープ	74

CNIPR 専利検索データベース

表7 特許ライセンサーランキング

	中国国内ライセンサー		外国ライセンサー	
1	蓝光联合	4070	Phillips	1647
2	华为技术	848	日本ディスプレイ	675
3	中兴通讯	844	松下 LCD	675
4	浙江大学	522	日立金属	519
5	比亚迪	388	マブチモーター	347
6	华南理工大学	343	PPG Industries	208
7	江南大学	255	Dolby Lab Licensing	206
8	东华大学	234	Nokia Siemens Networks	186
9	中国科学院计算技术研究所	226	Michelin	176
10	江苏大学	217	Lubrizol	162
11	天津大学	203	Bayer	160
12	西安交通大学	191	Hon Hai Prec.	154
13	上海交通大学	177	Delta Electronics	130
14	哈尔滨工业大学	175	太陽インキ	127
15	东南大学	170	松下電器産業	113
16	浙江工业大学	160	三洋電機	87
17	南京工业大学	151	Polyone	80
18	华东理工大学	144	日立製作所	74
19	清华大学	131	コニカミノルタ	72
20	鲁南制药	130	ソニー	69

CNIPR 法律状態データベース

4.2 中国国内出願人によるライセンス状況

表6の中国国内出願人の「ライセンスに関わる特許」のランキング順位は、表7の中国国内特許ライセンサーの順位と、その件数を含めて（一部を除き）大きな変動はない。これは各出願人から出願された特許がライセンス件数とほぼ1対1になっていることを示している。

また、中国科学院计算技术研究所は170件の「ライ

センスに関わる特許」を出願しているが、ライセンス件数は226件と増えている。226件のライセンス特許を調べてみると、同一特許を、2010年に「北京龙芯中科技术服务有限公司に排他許可」していたものを、2015年に同一企業と考えられる「龙芯中科技术服务有限公司に普通許可」というように契約内容の変更と考えられる57件があった特異な例である。

中国国内ライセンサーの多くは同一特許を複数のライセンサーにライセンスしているケースはほとんどない、という状況である。

国内ライセンサーの中では、**华为技術**（ファーウェイ）のように848件のライセンスの内、外国ライセンサー**苹果公司**（アップル）に805件もライセンスしているケースは珍しい。

また、**蓝光联合有限责任公司**のようなパテントプール会社によるライセンスもまれな例であるが、これは後述して検証する。

4.3 外国出願人によるライセンス状況

これに対して、外国ライセンサーの出願およびライセンスの状況は大きく異なる。これには2つのパターンがある。

1つは、「ライセンスに関わる特許」に比べてライセンスされている件数が少ない場合である。（表中の青色表示）

日立ディスプレイは、ライセンスに関わる特許を491件出願しているのに、ライセンサーとなってライセンスしているのは13件しかない。パナソニックや日立製作所もライセンス件数はライセンスに関わる特許の半分以下となっている。

同様に、三星電子もライセンスに関わる特許は223件存在するのに対し、ライセンス数は5件しかない。

このようにライセンスに関わる特許を多数有しながらライセンス数が少なくなっているのは、出願人が権利譲渡後、その譲受人がライセンスしているケースが法律状態項目に「実施許可（ライセンス）」として収録されるからである。

2つ目は、「ライセンスに関わる特許」に比べてライセンスされている件数が多い場合である（表中の黄色表示）。

Philipsはライセンスに関わる特許は62件であるのにライセンス数は1647件と際立って多く、日立金属はライセンスに関わる特許が33件に対してライセンス数は519件となっている。このように元となる特許数が少ないのにライセンス数が多い理由についても検証してみた。

その結果、Philipsは、1件の特許を100件以上のライセンサーにライセンスしているケースが多く、日立金属は、住友特殊金属や新王磁材などの権利をM&Aなどで譲り受け、ライセンサーとなっているためであることがわかった。

このようにライセンスの形態は様々であることがわかる（図4）。

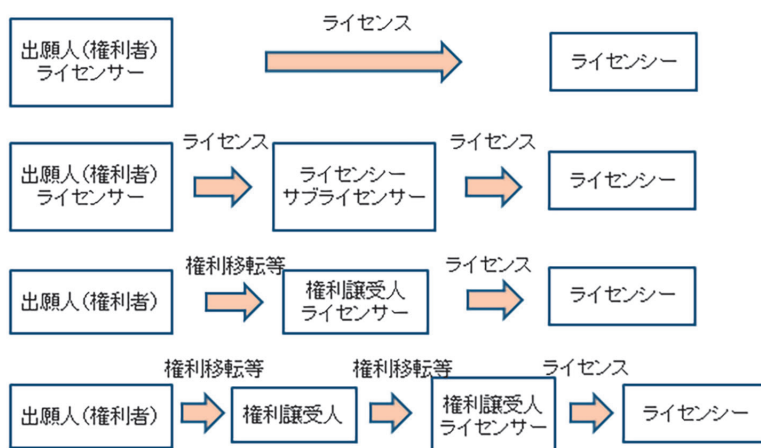


図4 ライセンスの各種形態

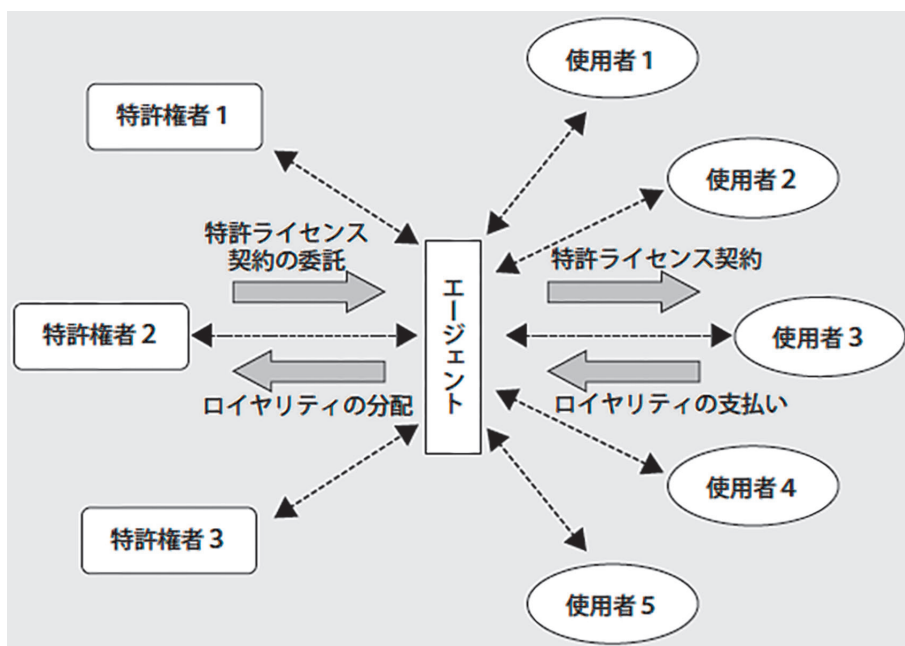


図5 パテントプールの活用

4.4 パテントプール会社によるライセンス

先に示したパテントプール会社「蓝光联合有限责任公司」によるライセンスについて検証する。パテントプールに関する多くの論考があるので、パテントプールの仕組みや運営方法などの詳細は割愛するが、以下のNTT論文にわかりやすい図があったので引用させていただいた(図5)¹³⁾。

標準化された技術のように多数の会社に関連する権利を有する場合に、その技術について権利行使しようとするれば権利を保有する多数の会社を相手にライセンス交渉することになる。仮にライセンス契約が成立したとしても多数の会社に対して個々にライセンスフィーを払うことになるので、結局、「非現実的なロイヤリティ」になってしまう(NTT論文を要約)ため、パテントプール会社を設立して利用するというものである。

蓝光联合有限责任公司は、2002年に設立された13社(ソニー、デル、ヒューレット・パッカード、日立製作所、LG電子、松下電器産業、三菱電機、パイオニア、フィリップス、サムスン電子、シャープ、TDK、トムソン)からなる「蓝光光盘協会(Blu-ray Disc Association(BDA))」がブルーレイディスク特許活用のために設立したパテントプール会社であり、2014年6月(公告日)

には4070件の内の4049件が以下の5社にライセンスされている。(いずれも中国企業)

- ・广东欧珀移动通信(829件)
- ・广州番禺巨大汽车音响设备(829件)
- ・中国华录集团(818件)
- ・深圳市麦思美科技(797件)
- ・TCL 通力电子(797件)

これら5社は、他社からも積極的にライセンスを受けて事業を展開していることもわかった。

また、蓝光联合の4070件のライセンスの基礎になっている特許の内訳は表8である。

表8 蓝光联合のライセンスの基礎出願

三星电子 (Samsung Electronics)	218
松下電器産業 (パナソニック)	178
LG 電子 (LG Electronics)	112
索尼 (ソニー)	101
先锋株式会社 (パイオニア)	80
日本勝利 (日本ビクター)	70
日立制作所 (日立製作所)	38
皇家飞利浦电子 (Philips)	36
夏普 (シャープ)	26
日立麦克赛尔 (日立マクセル)	1
三洋电机 (三洋電機)	1
基礎出願	861



4.5 実用新案、意匠のライセンス状況

実用新案と意匠についても同様に、專利データベースで「ライセンスに関わる出願人」と法律状態データベースから得られた「ライセンサーランキング」について検証したが、紙数の関係で詳細を報告できない。

特許とは異なり、ランキング上位には個人のライセンサーも多く見受けられ、特に、意匠については上位 20 件中 12 件が個人であった。

5 おわりに

以上のように、ライセンスや権利移転情報は、データベースから容易に検索できるようになったが、それぞれのデータベースから得られる情報を吟味しないと誤った情報を抽出しかねない。

特に、M&A や社名変更、権利譲渡などの情報も併せて把握する必要がある。

表6に示したように、專利データベースから得られる「ライセンスに関わる特許（專利）」のランキングも「ライセンスの基となった特許（專利）を提供した」という点では意義あるランキングリストであるが、必ずしもライセンスフィーを受領しているライセンサーではないことを留意することが重要である。

今後とも中国だけでなくワールドワイドに権利の授受が行われ、事業活動に寄与するものと思われるが、本稿の検証が情報を調査する担当者の一助になれば幸いである。

また、アジア特許情報研究会のメンバーからも「登記されないノウハウのような権利移転」はデータベースに収録されないので、そのすべてを把握することは困難である、など有益なアドバイスをいただいた。この場でお礼申し上げます。

本稿では、基本的に検索に用いる用語や表記例は、中国簡体字そのままの表記としたが、読者には判別していただけるものとして記述したことをお断りしておきたい。調査担当者でも見慣れない簡体字については日本語または英語を付記した。

参考文献

- 1) 中国特許庁：専利統計年報（2015）
<http://www.sipo.gov.cn/tjxx/tjyb/2015/201601/P020160114531916715830.pdf>
- 2) 日本知的財産協会・情報検索委員会：特許ライセンス活動の実態分析（知財管理誌 Vol.65, p1378（2015））
- 3) JETRO：中国ライセンスマニュアル（2011）
<https://www.jpo.go.jp/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/pdf/china3.pdf>
- 4) 藤本：中国ライセンス契約に関するスキーム比較（パテント Vol.64 p23 2011）
https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201110/jpaapatent201110_023-035.pdf
- 5) JETRO：中国におけるパテントトロールの実態および対策の研究に関する報告書（2010）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/report_2010-08.pdf
- 6) 劉：日本企業が中国現地会社へのライセンス時の留意点（北京林達劉知識産権代理事務所）
http://www.ryuka.com/home/uploads/patentinfo/seminar_84.pdf
- 7) 望月：中国企業からのロイヤリティー、またはサービスフィーによる利益回収（経営センサー 2010）
http://www.tbr.co.jp/pdf/sensor/sen_a136.pdf
- 8) JETRO：中国進出における委託加工貿易、技術ライセンスの契約・商標に関する Q&A 集（2008）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/pdf/china_qa_pamphlet.pdf
- 9) 萱野・今津：中国における為替管理（中国ビジネス・ローの最新実務 第 51 回（黒田法律事務所））
http://www.kuroda-law.gr.jp/pdf/china/ils_051.pdf
- 10) 王：中国独占禁止法による知的財産権濫用規制の新たな展開（2016）
http://www.jftc.go.jp/cprc/koukai/seminar/h27/40_notice.files/160201opseminar_3.pdf
- 11) 中国特許庁：専利実施許可合同备案登记相关信息（<http://www.sipo.gov.cn/tjxx/badjxx/>）
- 12) JETRO：タイ、ベトナム、インドネシアにおける知財リスク調査（2016）
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/asean/ip/pdf/report_201605.pdf
- 13) 渡部：特許プールを通じた標準化技術の特許ライセンス（NTT 技術ジャーナル 2005）
<http://www.ntt.co.jp/journal/0501/files/jn200501070.pdf>

上記 URL は、いずれも 2016 年 8 月 10 日に確認したものである。